

18,13

Оценка влияния адсорбции на проводимость однослойного эпитаксиального графена, сформированного на полупроводниковой подложке

© С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: Sergej_Davydov@mail.ru

(Поступила в Редакцию 1 июля 2014 г.)

Предложена простая модель влияния адсорбционного субмонослоя на статическую проводимость эпитаксиального графена, сформированного на полупроводниковой подложке, с учетом диполь-дипольного отталкивания адатомов. На примере двух предельных частных случаев показано, что адслоем увеличивает статическую проводимость эпитаксиального графена. Численные оценки проведены для адсорбции атомарных водорода и кислорода.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 12-02-00165а) и программой финансовой поддержки ведущих университетов РФ (субсидия 074-U01).

1. Введение

Высокая подвижность электронов, характерная для однослойного графена, находит применение в резистивных газовых сенсорах [1–3]. Ранее в работах [4,5] для металлических оксидов было показано, что главный эффект адсорбции, влияющий на поверхностную проводимость $\sigma_{\text{ег}}$, заключается в изменении поверхностной концентрации носителей. Было логично предположить, что и в случае эпитаксиального графена (ЭГ) имеет место тот же самый эффект. На основании этого предположения в работах [6,7] была построена теория влияния адсорбции на проводимость ЭГ, сформированного на металлической подложке. Было показано, в частности, что в случае вольфрамовой подложки адсорбция монослоя атомарного водорода ведет к уменьшению $\sigma_{\text{ег}}$ на $\delta\sigma_{\text{ег}}$, причем значения $\sigma_{\text{ег}}$ и $\delta\sigma_{\text{ег}}$ являются величинами одного порядка. В настоящей работе изучается тот же эффект, но для случая полупроводниковой подложки. Вновь из трех основных каналов взаимодействия адатомов [8] будем рассматривать только дипольное отталкивание.

2. Теория

Начнем с рассмотрения одиночного атома, адсорбированного на однолистном графене, сформированном на твердотельной подложке. Предполагаем далее, что на переход заряда между ЭГ и адатомом „работает“ только один квазиуровень последнего, характеризующийся энергией ε_a . Затем рассмотрим слой таких адатомов с безразмерной концентрацией $\Theta = N_a/N_{\text{ML}}$, где N_a (N_{ML}) — число адатомов в слое (в монослое), и включим между ними диполь-дипольное отталкивание, сдвигающее энергию квазиуровня ε_a в положе-

ние $\varepsilon_a(\Theta)$ [9,10]. Используя результаты работ [6–10], можем записать функцию Грина ЭГ, покрытого слоем адатомов, $\tilde{G}_{\text{ag}}(\varepsilon_{\pm}, \omega)$, в виде

$$\begin{aligned} \tilde{G}_{\text{ag}}(\omega, \Theta) &= G_{\text{ег}}^{\pm}(\omega) + \delta G_{\text{ag}}^{\pm}(\omega, \Theta), \\ G_{\text{ег}}^{\pm}(\omega) &= \frac{1}{\omega - \varepsilon_{\pm} - \lambda(\omega) + i\gamma(\omega)}, \\ \delta G_{\text{ag}}^{\pm}(\omega, \Theta) &= \frac{V^2}{(\omega - \varepsilon_{\pm} - \lambda(\omega) + i\gamma(\omega))^2} G_{\text{adlayer}}(\omega, \Theta), \\ G_{\text{adlayer}}(\omega, \Theta) &= \Theta G_a(\omega, \Theta), \\ G_a(\omega, \Theta) &= \frac{1}{\omega - \varepsilon_a(\Theta) - \Lambda(\omega) + i\Gamma(\omega)}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь $G_{\text{ег}}^{\pm}(\omega)$ — функция Грина (ФГ) невозмущенного ЭГ, $\delta G_{\text{ag}}^{\pm}(\omega, \Theta)$ — изменение этой ФГ под влиянием адсорбции, описываемой матричным элементом V , связывающим адатом с ЭГ, $G_{\text{adlayer}}(\omega, \Theta)$ — ФГ адслоя, $G_a(\omega, \Theta)$ — ФГ адатома в адслое, ω — энергетическая переменная; $\Lambda(\omega)$ и $\Gamma(\omega)$, пропорциональные V^2 , представляют собой соответственно функции сдвига и уширения квазиуровня адатома [6,7], $\varepsilon_{\pm} = \varepsilon_{\text{D}} + \lambda(\omega) \pm \varepsilon_q$, $\varepsilon_q = (3ta/2)|\mathbf{q}|$, где ε_{D} — энергия точки Дирака, совпадающая с энергией $|p_z\rangle$ -уровня атома углерода, $\lambda(\omega)$ и $\gamma(\omega)$ — функции сдвига и уширения квазиуровня атома углерода ЭГ, возникающие вследствие взаимодействия V_{sc} атома углерода графена с твердотельной подложкой, пропорциональные V_{sc}^2 (см. далее), t — энергия перехода электрона между состояниями $|p_z\rangle$ соседних атомов свободного графена, \mathbf{q} — волновой вектор графена, отсчитываемый от волнового вектора точки Дирака \mathbf{K} , знаки \pm относятся соответственно к зоне проводимости и валентной зоне ЭГ,

$\varepsilon_a(\Theta) = \varepsilon_a - \xi \Theta^{3/2} Z_a(\Theta)$ — энергия квазиуровня адатома при учете диполь-дипольного отталкивания, ξ — константа дипольного взаимодействия, $Z_a(\Theta)$ — заряд адатома в слое [10].

Для вычисления статической проводимости ЭГ в присутствии адслоя $\tilde{\sigma}_{eg}$ будем использовать формализм Кубо–Гринвуда для нулевой температуры [11,12], откуда получим

$$\tilde{\sigma}_{eg} = \sigma_{eg} + \delta\sigma_{eg},$$

$$\sigma_{eg} = \frac{e^2}{\pi\hbar} \int_0^\xi \left\{ [\text{Im} G_{eg}^+(\Omega_F)]^2 + [\text{Im} G_{eg}^-(\Omega_F)]^2 \right\} \varepsilon_q d\varepsilon_q,$$

$$\delta\sigma_{eg} = \frac{e^2}{\pi\hbar} \int_0^\xi \Psi(\Omega_F, \Theta) \varepsilon_q d\varepsilon_q,$$

$$\begin{aligned} \Psi(\Omega_F, \Theta) = & \{ \text{Im} \delta G_{ag}^+(\Omega_F, \Theta) + \text{Im} \delta G_{ag}^-(\Omega_F, \Theta) \}^2 \\ & + 2 [\text{Im} G_{eg}^+(\Omega_F) + \text{Im} G_{eg}^-(\Omega_F)] \\ & \times [\text{Im} \delta G_{ag}^+(\Omega_F, \Theta) + \text{Im} \delta G_{ag}^-(\Omega_F, \Theta)], \quad (2) \end{aligned}$$

где σ_{eg} — проводимость невозмущенного ЭГ [12], $\delta\sigma_{eg}$ — изменение проводимости ЭГ, вызванное адслоем, $\Omega_F = \varepsilon_F - \varepsilon_D - \lambda_F$, ε_F — энергия Ферми, $\lambda_F = \lambda(\varepsilon_F)$, $\xi = 2\tau a q_c / 2$ — энергия обрезания, соответствующая волновому вектору обрезания q_c . Из (1) получим для слагаемых, входящих в функцию $\Psi(\Omega_F, \Theta)$,

$$\text{Im} G_{eg}^\pm(\Omega_F) = -\frac{\gamma_F}{(\Omega_F \mp \varepsilon_q)^2 + \gamma_F^2},$$

$$\begin{aligned} \text{Im} \delta G_{ag}^\pm(\Omega_F, \Theta) = & -\Theta V^2 \Gamma_F \frac{(\Omega_F \mp \varepsilon_q)^2 - \gamma_F^2}{[(\Omega_F \mp \varepsilon_q)^2 + \gamma_F^2]^2} \\ & \times \frac{1}{B_F^2(\Theta) + \Gamma_F^2} - 2\Theta V^2 \gamma_F \frac{\Omega_F \mp \varepsilon_q}{[(\Omega_F \mp \varepsilon_q)^2 + \gamma_F^2]^2} \frac{B_F(\Theta)}{B_F^2(\Theta) + \Gamma_F^2}. \quad (3) \end{aligned}$$

Здесь $\gamma_F = \gamma(\varepsilon_F)$, $B_F(\Theta) = \varepsilon_F - \varepsilon_a(\Theta) - \Lambda_F$, $\Lambda_F = \Lambda(\varepsilon_F)$, $\Gamma_F = \Gamma(\varepsilon_F)$. Цель настоящей работы состоит в оценке $\delta\sigma_{eg}$, так как проводимость ЭГ σ_{eg} уже обсуждалась в [12].

Для дальнейших оценок необходимо принять модель плотности состояний субстрата $\rho_{sc}(\omega)$. Выбираем в качестве подложки полупроводник, описывая его плотность состояний в рамках модели, принятой в работах [12,13]:

$$\rho_{sc}(\omega) = \begin{cases} A \sqrt{\text{sgn}(\omega)\omega - E_g/2}, & |\omega| > E_g/2, \\ 0, & |\omega| \leq E_g/2, \end{cases} \quad (4)$$

где E_g — ширина запрещенной зоны, A — коэффициент.

Для исключения перехода заряда между подложкой и графеном при $T = 0$ достаточно потребовать, чтобы $|\varepsilon_D| < E_g/2$ [12]. Еще одним условием задачи яв-

ляется отсутствие щели в спектре графена, которую может навести полупроводниковая подложка, достаточным условием чего является выполнение неравенства $\pi AV_{sc}^2 / \sqrt{E_g} < 1$ [12], где V_{sc} — матричный элемент, связывающий состояние $|p_c\rangle$ атома углерода графена с полупроводниковой подложкой. Выполнение последнего условия гарантирует, что мы имеем квазисвободный (т.е. бесщелевой) однолистный графен, который только и будем рассматривать далее.

3. Частные случаи

Используя плотность состояний (4), легко показать (см. подробнее [12]), что статическая проводимость ЭГ, сформированного на полупроводнике, будет отлична от нуля и равна $\sigma_{sc} = 2e^2/\pi\hbar$ только при выполнении условия $\Omega_F = 0$. Это последнее условие отвечает перекрытию уровня Ферми (химического потенциала) с положением сдвинутой (за счет взаимодействия с подложкой) точки Дирака, т.е. когда $\varepsilon_F = \varepsilon_D + \lambda_F$, так как $\lambda_F = AV_{sc}^2(F_-(\varepsilon_F) - F_+(\varepsilon_F))$ и $F_\pm(\varepsilon_F) = \pi \sqrt{\pm\varepsilon_F + E_g/2}$ [12,13]. Простейшим решением уравнения $\Omega(\varepsilon_F = 0)$ является $\varepsilon_F = \varepsilon_D = 0$, что дает $\lambda_F = 0$. Рассмотрим этот случай, считая его нулевым приближением более общего условия $|\Omega_F| \ll E_g, \xi$.

Считая (как и в [12]) полупроводник невырожденным, т.е. полагая $-E_g/2 \leq \varepsilon_F \leq E_g/2$, с учетом $\gamma_F = 0$ (см. (4)) из (3) получим

$$\text{Im} G_{eg}^\pm(\Omega_F) = 0,$$

$$\text{Im} \delta G_{ag}^\pm(\Omega_F, \Theta) = -\Theta \pi V^2 \rho_a(\varepsilon_F, \Theta) / \varepsilon_q^2, \quad (5)$$

где

$$B_F(\Theta) = \varepsilon_F - \varepsilon_a(\Theta) - \Lambda_F, \quad \Lambda_F = \Lambda(\varepsilon_F), \quad \Gamma_F = \Gamma(\varepsilon_F),$$

$$\rho_a(\varepsilon_F, \Theta) = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma_F}{B_F^2(\Theta) + \Gamma_F^2}. \quad (6)$$

Подставляя эти выражения в (2), имеем

$$\delta\sigma_{eg} = \frac{2e^2}{\pi\hbar} \Theta^2 (\pi V^2 \rho_a(\Omega_F, \Theta))^2 \int_0^{\xi^2} y^{-2} dy. \quad (7)$$

Легко видеть, что интеграл (7) расходится на нижнем пределе, что является нефизическим результатом. Чтобы этого избежать, воспользуемся приемом, впервые использованным Алисултановым в работе [11], т.е. будем полагать, что конечное время жизни электронов в ЭГ $\tau(\omega) \sim \hbar/\lambda(\omega)$ связано не только с возможностью их туннелирования в подложку, но и с другими процессами неупругого рассеяния, так что в области запрещенной зоны полупроводникового субстрата функция уширения $\lambda(\omega)$ остается конечной и равной значению $\lambda^*(= \text{const})$.

Тогда, считая λ^* самым малым энергетическим параметром задачи и используя результаты работы [6], получим

$$\delta\sigma_{\text{ег}} \approx \frac{2e^2}{3\pi\hbar} \Theta^2 (\pi V^2 \rho_a(0, \Theta))^2 / (\lambda^*)^2, \quad (8)$$

так что

$$\delta\sigma_{\text{ег}}/\sigma_{\text{sc}} \approx \Theta^2 (\pi V^2 \rho_a(0, \Theta))^2 / 3(\lambda^*)^2, \quad (9)$$

где учтено, что $\sigma_{\text{sc}} = 2e^2/\pi\hbar$. Таким образом, в данном случае адсорбция приводит к увеличению статической поверхностной проводимости.

Теперь рассмотрим противоположный предельный случай $|\Omega_{\text{F}}| \gg E_{\text{g}}, \xi$. Из (3) получаем

$$\text{Im } G_{\text{ег}}^{\pm}(\Omega_{\text{F}}) = 0,$$

$$\text{Im } \delta G_{\text{эг}}^{\pm}(\Omega_{\text{F}}, \Theta) = -\Theta \pi V^2 \rho_a(\Omega_{\text{F}}, \Theta) / \Omega_{\text{F}}^2. \quad (10)$$

Тогда

$$\delta\sigma_{\text{ег}} \approx \frac{2e^2}{\pi\hbar} \Theta^2 (\pi V^2 \rho_a(\Omega_{\text{F}}, \Theta))^2 (\xi^2 / \Omega_{\text{F}}^4). \quad (11)$$

Следовательно, и в данном случае $\delta\sigma_{\text{ег}} > 0$. Более того, так как по данным [12] при $\Omega(\varepsilon_{\text{F}}) \neq 0$ имеем $\sigma_{\text{sc}} = 0$, получается, что именно наличие адсорбата приводит к появлению статической поверхностной проводимости ЭГ. И так, в обоих случаях (с учетом $\lambda^* \rightarrow 0$) наличие адсорбата приводит к скачку проводимости.

4. Численные оценки

Перейдем теперь к численным оценкам, считая, что в качестве подложки выступают политипы карбида кремния. Воспользовавшись приведенными в работе [14] значениями электронного сродства χ и ширин запрещенных зон E_{g} (взятых из [15,16]), легко рассчитать положение центра запрещенной зоны политипов карбида кремния $E_0 = -\chi - E_{\text{g}}/2$ относительно вакуума (см. таблицу). С другой стороны, для работы выхода свободного графена ϕ рассмотрим наибольшее (5.11 eV [17]) и наименьшее (4.26 eV [18]) из известных нам значений. Поскольку относительно вакуума $\varepsilon_{\text{D}} = -\phi$, имея в виду лишь порядковые оценки, условие $|\Omega(\varepsilon_{\text{F}})| \ll E_{\text{g}}, \xi$ для $\phi = 5.11$ eV можно считать близким к выполнению (отметим, что $\xi \leq 2.38$ eV). Тогда из выражения (8) следует, что максимальным увеличение проводимости будет для адсорбатов, обладающих максимальным значением произведения $V^2 \rho_a(0, \Theta)$ и минимальной величиной λ^* .

Для оценок значений V и $\rho_a(0, \Theta)$ воспользуемся методом связывающих орбиталей (МСО) [19,20]. В соответствии с МСО матричный элемент $V = \eta_{p\sigma} \hbar^2 / m(r_{\text{C}} + r_{\text{X}})^2$, где $\eta_{p\sigma}$ — численный коэффициент, отвечающий σ -связи $|p_z\rangle$ -орбитали углерода графена с $|l\rangle$ -состоянием адатома X; $r_{\text{C},\text{X}}$ — атомный радиус $C(X)$. Так, например, взяв для атома водорода в качестве атомного радиуса радиус Бора

Значения электронного сродства χ (по данным [14]), ширины запрещенной зоны E_{g} [15,16] и центра запрещенной зоны политипов карбида кремния относительно вакуума $E_0 = -\chi - E_{\text{g}}/2$ (в eV)

Параметр	Политип					
	8H	21R	6H	15R	27R	4H
χ	3.58	3.52	3.45	3.33	3.27	3.17
E_{g}	2.86	2.96	3.00	3.06	3.13	3.23
$-E_0$	5.01	5.00	4.95	4.96	4.84	4.79

$r_{\text{B}} = 0.53 \text{ \AA}$, с учетом значений $\eta_{p\sigma} = 1.42$ [20] и $r_{\text{C}} = 0.77 \text{ \AA}$ [21] получим $V = 6.40$ eV. Для атома кислорода $\eta_{p\sigma} = 2.22$ [20] и $r_{\text{O}} = 0.74 \text{ \AA}$ [21] имеем $V = 7.42$ eV. Таким образом, с точки зрения матричного элемента связи адатом–ЭГ различия несущественны.

Далее логично предположить, что плотность состояний $\rho_a(0, \Theta)$ для данного покрытия тем больше, чем ближе величина $B_{\text{F}}(\Theta) = \varepsilon_{\text{F}} - \varepsilon_a(\Theta) - \Lambda_{\text{F}}$ к нулю, т.е. при $\varepsilon_a(\Theta) \approx 0$ и $\Lambda_{\text{F}} \approx 0$. Значение $\varepsilon_a(0)$ для адатомов водорода относительно вакуума можно оценить из выражения $\varepsilon_a(0) = -I + e^2/4r_{\text{B}}$ ($I = 13.60$ eV есть энергия ионизации [19], e — заряд позитрона), что дает $\varepsilon_a(0) = -6.81$ eV. Для адатомов кислорода относительно вакуума имеем $\varepsilon_a(0) = -A - e^2/4r_{\text{O}}$, где сродство к электрону $A = 1.46$ eV [21], откуда $\varepsilon_a(0) = -6.32$ eV. Очевидно, что в случае малых покрытий и здесь не наблюдается сколь-либо существенных различий между адсорбцией водорода и кислорода.

К сожалению, второй предельный случай $|\Omega(\varepsilon_{\text{F}})| \gg E_{\text{g}}, \xi$ не реализуется (по нашим оценкам) даже для максимального значения работы выхода графена $\phi = 4.26$ eV [18].

5. Заключение

Полученные в настоящей работе оценки показывают в двух предельных случаях рост статической поверхностной проводимости графена $\sigma_{\text{г}}$, причем в обоих случаях $\delta\sigma_{\text{ег}}/\sigma_{\text{ег}} \gg 1$. Следует, конечно, оговориться, что использованные здесь и ранее (см. [6,7,12]) модели весьма грубы. Однако построение более сложных конструкций в рамках метода модельных гамильтонианов неизбежно приведет к увеличению параметров, значения которых можно определить только из экспериментальных данных, в настоящее время отсутствующих. Таким образом, в плане предложенного здесь подхода приходится ограничиться полученными результатами.

В подтверждение такого вывода отметим, что вопрос о статической проводимости в точке Дирака даже свободного однослойного недопированного графена до сих пор является дискуссионным. Так, например, в обзоре [22] по данным разных авторов приводятся значения $\sigma_{\text{г}}$, равные $4e^2/\pi\hbar$, $\pi e^2/2\hbar$, 0 , ∞ , тогда как в [23] дается величина $\sigma_{\text{г}} = e^2/\pi\hbar$.

Список литературы

- [1] F. Schedin, A.K. Geim, S.V. Morozov, E.H. Hill, P. Blake, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov. *Nature Mater.* **6**, 652 (2007).
- [2] S. Basu, P. Bhattacharya. *Sensors Actuators B* **173**, 1 (2013).
- [3] E. Llobet. *Sensors Actuators B* **179**, 32 (2013).
- [4] С.Ю. Давыдов, В.А. Мошников, А.А. Федотов. *ЖТФ* **51**, 1, 141 (2006).
- [5] Д.Г. Аньчков, С.Ю. Давыдов. *ФТТ* **53**, 820 (2011).
- [6] S.Yu. Davydov. *Phys. Lett. A* **378**, 1850 (2014).
- [7] С.Ю. Давыдов. *Письма в ЖТФ* **40**, 13, 52 (2014).
- [8] О.М. Браун, В.К. Медведев. *УФН* **32**, 631 (1989).
- [9] С.Ю. Давыдов. *ФТП* **47**, 97 (2013); *ФТТ* **53**, 2414 (2011).
- [10] С.Ю. Давыдов, С.В. Трошин. *ФТТ* **49**, 1508 (2007).
- [11] З.З. Алисултанов. *Письма в ЖТФ* **39**, 17, 8 (2013).
- [12] С.Ю. Давыдов. *ФТТ* **56**, 816 (2014).
- [13] С.Ю. Давыдов. *ФТП* **48**, 49 (2014); *ЖТФ* **84**, 4, 155 (2014).
- [14] С.Ю. Давыдов. *ФТП* **41**, 718 (2007).
- [15] В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко. *Оптические свойства полупроводников. Справочник. Наук. думка, Киев (1987). 620 с.*
- [16] W.R.L. Lambrecht, S. Limpijumnog, B. Segall. *Inst. Phys. Conf. Ser.* **142**, Ch. 2, 263 (1996).
- [17] A. Mattaush, O. Pankratov. *Phys. Rev. Lett.* **99**, 076 802 (2007).
- [18] K.T. Chan, L.B. Neaton, M.L. Cohen. *Phys. Rev. B* **77**, 235 430 (2008).
- [19] У. Харрисон. *Электронная структура и свойства твердых тел. Мир, М. (1983).*
- [20] W.A. Harrison. *Phys. Rev. B* **27**, 3592 (1983).
- [21] *Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1232 с.*
- [22] S. Das Sarma, S. Adam, E.H. Huang, E. Rossi. *Rev. Mod. Phys.* **83**, 407 (2011).
- [23] D.S.L. Abergel, V. Apalkov, J. Berashevich, K. Ziegler, T. Chakraborty. *Adv. Phys.* **59**, 261 (2010).